

多晶硅还原炉

1 多晶硅只沉积在硅棒，而在还原炉的底部没有，沉积条件怎样，原理是什么，为什么下部较光滑而上部粗糙？

上部由于横梁搭接处横梁和硅棒互相辐射导致温度较高，生长的快

只沉积在硅棒是因为硅棒是通电后发热，使得硅棒本身温度很高，从而达到反应温度而沉积在其表面；而其他部分如底盘未反应是因为其温度相对较低，而且还有冷却水进行冷却，所以不会在这些部位进行反应。

上部不光滑是因为热辐射较多，造成表面发热不均，从而沉积速度不一样。